

540, 232

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
15. Juli 2004 (15.07.2004)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2004/059045 A2

(51) Internationale Patentklassifikation⁷: **C25D 17/10**

(21) Internationales Aktenzeichen: **PCT/EP2003/014785**

(22) Internationales Anmeldedatum:
23. Dezember 2003 (23.12.2003)

(25) Einreichungssprache: **Deutsch**

(26) Veröffentlichungssprache: **Deutsch**

(30) Angaben zur Priorität:
102 61 493.8 23. Dezember 2002 (23.12.2002) **DE**

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): **METAKEM GESELLSCHAFT**

FÜR SCHICHTCHEMIE DER METALLE MBH
[DE/DE]; Achtzehnmorgenweg 3, 61250 Usingen (DE).
M.P.C. Micropulse Plating Concepts [FR/FR]; 1 Avenue
Leclerc, F-69007 Lyon (FR).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): **WURM, Jörg**
[DE/DE]; Margarethenstr. 10, 61476 Kronberg (DE).
MENARD, Stephane [FR/FR]; 25 Bis Avenue due Point
du Jour, F-69005 Lyon (FR).

(74) Anwälte: **GROSS, Ulrich-Maria** usw.; Uexküll & Stol-
berg, Beselerstr. 4, 22607 Hamburg (DE).

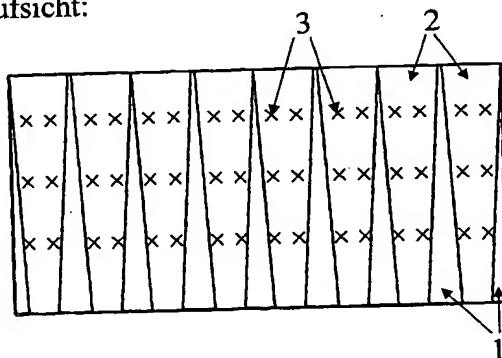
(81) Bestimmungsstaaten (national): **AE, AG, AL, AM, AT,**
AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN,
CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI,

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

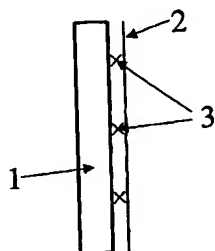
(54) Title: **ANODE USED FOR ELECTROPLATING**

(54) Bezeichnung: **ANODE ZUR GALVANISIERUNG**

AA
Draufsicht:



BB
Seitenansicht:



AA... TOP VIEW
BB... SIDE VIEW

(57) Abstract: The invention relates to an anode which is used for electroplating and comprises a basic member and a shield. Said anode is characterized by the fact that additive decomposition is reduced during use thereof in an electroplating process.

(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft eine Anode zur Galvanisierung, die einen Anoden-Grundkörper und eine Abschirmung aufweist und sich dadurch auszeichnet, dass bei ihrer Verwendung bei der Galvanisierung der Additiv-Abbau reduziert ist.

WO 2004/059045 A2